

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第2区分

【発行日】平成28年2月4日(2016.2.4)

【公開番号】特開2014-127532(P2014-127532A)

【公開日】平成26年7月7日(2014.7.7)

【年通号数】公開・登録公報2014-036

【出願番号】特願2012-281837(P2012-281837)

【国際特許分類】

H 01 L 21/02 (2006.01)

H 01 L 21/68 (2006.01)

【F I】

H 01 L 21/02 B

H 01 L 21/68 F

【手続補正書】

【提出日】平成27年12月11日(2015.12.11)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

第1の基板と第2の基板とを互いに重ね合せる基板処理装置であって、

前記第1の基板を保持する第1ステージと、

前記第2の基板を保持し、前記第1ステージに向けて移動して前記第1の基板および前記第2の基板を互いに重ね合わせる第2ステージと、

前記第2ステージの位置を測定する測定部と、

前記第1の基板と前記第2の基板との接触による前記測定部の振動を抑制する振動抑制部と、

を備える基板処理装置。

【請求項2】

前記振動抑制部は、前記接触により前記第1ステージに生じた振動が前記測定部に伝達されることを抑制する請求項1に記載の基板処理装置。

【請求項3】

前記振動抑制部は、前記第1ステージと前記測定部との間で振動が伝達される経路に配置され、前記第1ステージから伝達される振動を減衰させる制振部を含む請求項2に記載の基板処理装置。

【請求項4】

前記制振部は、前記振動を減衰させるマスダンパおよびアクティブマスダンパの少なくとも一方を含む請求項3に記載の基板処理装置。

【請求項5】

前記振動抑制部は、前記測定部に伝達された前記振動を抑制する請求項1に記載の基板処理装置。

【請求項6】

前記振動抑制部は、前記振動を減衰させるマスダンパおよびアクティブマスダンパの少なくとも一方を含む請求項5に記載の基板処理装置。

【請求項7】

前記振動抑制部は、前記測定部を含む振動の系の固有振動数を変化させる付加質量を含

む請求項 1 から 6 のいずれか一項に記載の基板処理装置。

【請求項 8】

前記第 1 ステージを支持する枠体を備え、

前記測定部は、前記枠体に支持される請求項 1 から 7 のいずれか一項に記載の基板処理装置。

【請求項 9】

前記測定部は、前記第 2 ステージに設けられた反射鏡に測長ビームを照射する干渉計である請求項 1 から 8 のいずれか一項に記載の基板処理装置。